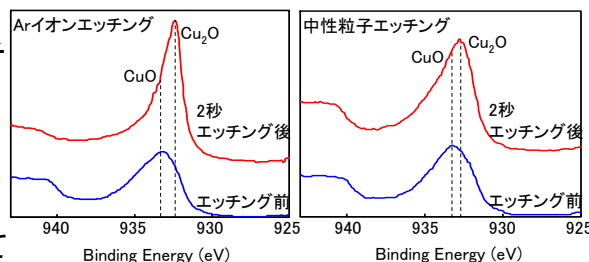


JPS-9010シリーズ JPS-9200のオプションについて

JPS-9010シリーズ用オプション

▶ 中性粒子エッチング銃 XP-02110

150~600eVの電荷を持たないAr中性粒子でスパッタエッチングを行うため、通常のArイオンによるものと比べ、試料表面の荒れ・化学結合状態変化・構造破壊を軽減できます。右図に両エッチング銃を使用して、CuO(2価)をエッチングした場合のCu₂p_{3/2}スペクトルの変化を示します。中性粒子の場合、CuOからCu₂Oへの還元量が少なくなっています。



Cu₂p_{3/2}スペクトルの変化

▶ 試料加熱ホルダ (特別オプション)



試料ステージに装着し、in-situで試料加熱処理を行うことが可能な試料ホルダです。500°Cまで加熱可能です。

▶ トランスファベッセル

XP-02200TRV1 (JPS-9010MX, MC用)

XP-02210TRV2 (JPS-9010TR用)

* JPS-9200用は特別オプション

ベッセル内部に専用試料ホルダを格納し、お客様用意の試料作成装置あるいはグローブボックスから試料交換室まで、試料を大気に曝すことなく搬送することができます。また、JAMP-9500F(オージェ電子分光装置)との間で試料交換が可能なタイプのベッセルを用意することも出来ます。この場合、試料ホルダも両装置間で共用できます。



▶ UPS光源 (特別オプション)

励起光として数十eVの紫外線を使用する紫外線光電子分光法(UPS)測定を行うためのUPS光源です。

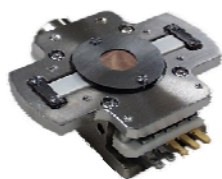
UPS法は価電子帯の構造を高エネルギー分解能で分析可能です。

▶ マイクロ分析ユニット XP-04100

試料と入射レンズの先端に視野制限絞りを挿入することによって、測定視野を1.0mmφ、0.5mmφ、0.2mmφの3段階に制限することができます。

▶ 試料処理室 (特別オプション)

本体試料交換室後方に装着し、In-situで加熱処理、ガス反応処理を行います。試料を大気に曝すことなく分析室へ移動させ、XPS測定を行うことができます。導入ガスとしてH₂、O₂、N₂などが使用可能です。



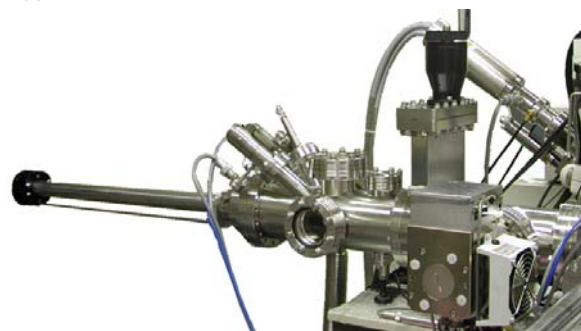
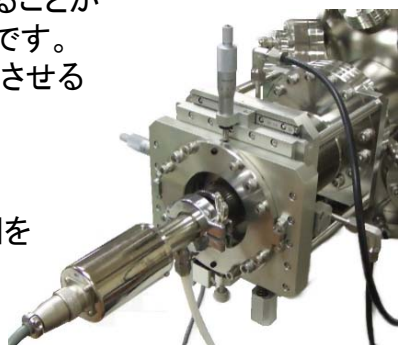
専用試料ホルダ

加熱ヒータ: PG/PBNヒータ
 加熱温度: 400°C
 (10²Paの真空内にて)
 試料サイズ: φ12 mm × 0.1mm t

JPS-9200シリーズ用オプション

▶ 磁界レンズシフタ (特別オプション)

試料ホルダ下に位置する磁界レンズを最大25mm下へ移動させることができる保持ステージです。レンズを下方へ移動させることで、厚みのある試料をホルダ上に充填させたり、試料ステージの可動範囲を広げる事が可能です。



試料処理室